

(四) 111 年發明專利新申請案件數依國際專利三階分類排行 (前 20 名)

排名	國際專利分類 (三階)	分類內容簡述	件數
1	H01L	半導體裝置；其他類目不包括的電固體裝置	6,784
2	G06F	電子數位資料處理	2,681
3	A61K	醫用、牙科用或梳妝用之配製品	1,998
4	G02B	光學元件、系統或儀器	1,113
5	C07D	雜環化合物	993
6	G06Q	電子商務	971
7	H05K	印刷電路；電氣設備之外殼或結構零部件；電氣元件組件之製造	929
8	C08G	用碳 - 碳不飽和鍵以外之反應而得的高分子化合物	802
9	C07K	肽類	799
10	G03F	圖紋面之照相製版工藝；其所用材料；其所用原版；其所專用設備	789
11	G11C	靜態儲存裝置	777
12	H04W	無線通訊網路	768
13	G01N	借助於測定材料之化學或物理性質用以測試或分析材料	726
14	C23C	對金屬材料之鍍覆；用金屬材料對材料之鍍覆	718
15	H04N	影像通信	716
16	B32B	層狀產品	691
17	G01R	測量電變量；測量磁變量	632
18	C08F	僅用碳 - 碳不飽和鍵反應而得的高分子化合物由低碳烴製造液態烴混合物	547
19	C08L	高分子化合物之組合物	540
20	H04L	數位資訊之傳輸	514

統計日期：113 年 1 月 11 日

註：1. 依專利申請案件數由大至小排序。

2. 詳細之國際專利分類內容描述請見國際專利分類第 2023.01 版。

3. 新申請案件因尚有分類時程之落差，無法及時提供年報當年度件數，爰以年報年度以前 1 年之件數為統計基礎。